

平成20年度中間評価結果の反映について

1. 各事業の対処方針について

平成20年度中間評価対象事業22件のうち下記の2件について、3月27日開催された研究評価委員会においてまとめられた評価結果を踏まえ、関係推進部、企画調整部において対処方針を協議した結果、次の方針で対応することとする。

概ね、現行どおり実施する事業: 2件

- ・「低損失オプティカル新機能部材技術開発」
- ・「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト(うち「次世代マスク基盤技術開発」について)」

(参考)平成20年度 中間評価結果一覧

<u>テーマの一部を加速して実施(2件)</u>	先端機能発現型新構造繊維部材基盤技術の開発 次世代光波制御材料・素子化技術
<u>概ね、現行どおり実施(15件)</u>	糖鎖機能活用技術開発 新機能抗体創製技術開発 革新的マイクロ反応場利用部材技術開発 カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト 環境適応型高性能小型航空機研究開発 水素先端科学基礎研究事業 微生物機能を活用した高度製造基盤技術開発 三次元光デバイス高効率製造技術 染色体解析技術開発 マグネシウム鍛造部材技術開発プロジェクト 系統連系円滑化蓄電システム技術開発 次世代プロセスフレンドリー設計技術開発 高機能簡易型有害性評価手法の開発 <u>次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト</u> <u>低損失オプティカル新機能部材技術開発</u>
<u>計画を一部変更し実施(3件)</u>	スピントロニクス不揮発性機能技術 ナノ粒子特性評価手法の研究開発 次世代輸送系システム設計基盤技術開発
<u>中止または抜本的な改善(2件)</u>	ゲノム創薬加速化支援バイオ基盤技術開発/ 化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発 新利用形態燃料電池標準化等技術開発